

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

= 5,364,977

(11) Publication number: 0616646 A

(43) Date of publication of application: 14.06.94

(51) Int. CI

C07C 39/15 C07C 39/367 C07C 41/18 C07C 43/23

(21) Application number: 04345524

(71) Applicant:

NIPPON SODA CO LTD

(22) Date of filing: 01.12.92

(72) Inventor:

SUZUKI HIROYUKI ICHIKAWA TAKAKO

(54) NEW CLATHRATE COMPOUND AND ITS **PRODUCTION**

(57) Abstract:

PURPOSE: To obtain a clathrate compound capable of including a wide variety of organic compounds and useful in the technological fields of selective separation, chemical stabilization, involatilization, pulverization, etc., by using a tetrakisphenol compound as a host compound.

CONSTITUTION: The objective clathrate compound is produced by using a compound of formula [X is (CH₂)_n (n is 0-3); R1 and R2 are H, lower alkyl, (substituted)phenyl, halogen or lower alkyl excluding the case that (n) is O and \mathbb{R}^2 R^1 and are 1,1,2,2-tetrakis(3-methyl-4-hydroxyphenyl)ethane host compound. The objective new clathrate compound can be produced in extremely high efficiency by directly adding the compound of formula to an organic compound to be used as a guest and reacting with each other when the guest compound is liquid or by directly reacting the compound of formula with a guest compound in solid phase when the guest compound is solid.

COPYRIGHT: (C)1994,JPO&Japio

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平6-166646

(43)公開日 平成6年(1994)6月14日

(51)Int.Cl.⁵

識別記号

庁内整理番号

FΙ

技術表示箇所

C07C 39/15

39/367

8930-4H 8930-4H

41/18

43/23

C 7419-4H

審査請求 未請求 請求項の数2(全13頁)

(21)出願番号

特願平4-345524

(22)出願日

平成 4年(1992)12月1日

(71)出願人 000004307

日本曹達株式会社

東京都千代田区大手町2丁目2番1号

(72)発明者 鈴木 啓之

千葉県市原市五井南海岸12-54 日本曹達

株式会社機能製品研究所内

(72)発明者 市川 多加子

千葉県市原市五井南海岸12-54 日本曹達

株式会社機能製品研究所内

(74)代理人 弁理士 東海 裕作 (外1名)

(54)【発明の名称】 新規包接化合物及びその製造方法

(57)【要約】

【目的】テトラキスフェノール類をホストとする新規な 包接化合物を提供する。

【構成】一般式〔I〕で示されるテトラキスフェノール

類をホストとして、種々の有機化合物をゲストとする包 接化合物が、無溶媒、場合によっては溶媒希釈下に反応 させることにより、容易かつ効率よく得られる。

【化1】

(式中、Xは(CH_2) nを表し、nは、 $0\sim3$ の整数を示し、 R^1 、 R^2 は、水素原子、低級アルキル基、ハロゲン原子、低級アルコキシ基を示す。)

【効果】テトラキスフェノール類をホストとすることに

より、広範囲な有機化合物が包接でき、選択分離、化学 的安定化、不揮発性化、粉末化などの技術分野において 有用な包接化合物および包接化の技術が提供される。

(I)

【特許請求の範囲】

【請求項1】一般式〔I〕で示されるテトラキスフェノ

ールをホスト化合物とすることを特徴とする包接化合 *

1

(式中、Xは、 (CH_2) n を表し、nは、0、1、2又は3であり、 R^1 、 R^2 は、それぞれ水素原子、低級アルキル基、置換されていてもよいフェニル基、ハロゲン原子または低級アルコキシ基を示す。但し、nが0で、 R^1 、 R^2 がともに水素原子である場合を除く。)

【請求項2】テトラキスフェノールのホスト化合物とゲスト有機化合物とを反応してなることを特徴とする請求項1記載の包摂化合物の製造方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、新規包接化合物に係 り、更に詳しくはテトラキスフェノールをホスト化合物 とする包接化合物及びその製造方法に関する。

[0002]

【従来の技術】包接化合物は、ホスト分子の作る空洞内 にゲスト分子が入り込んだ構造を有する化合物であり、 近年、選択分離、化学的安定化、不揮発化、粉末化など の技術分野における応用が期待されている。従来の包接 化合物としては、例えば、特開昭61-53201号公 報には、1,1,6,6-テトラフェニル-2,4-へ キサジイン-1,6-ジオール又は1,1-ジ(2,4 ージメチルフェニル) -2-プロピン-1-オールを、 特開昭62-22701号公報には、1,1'-ビスー 2-ナフトールをそれぞれホストとして、5-クロロー 2-メチル-4-イソチアゾリン-3-オン(CMI) 等をゲストとするもの等が知られている。また、テトラ キスフェノール類をホストとする包接化合物は、テトラ キス (4-ヒドロキシフェニル) エタンをホストとする もの以外は、いまだ知られていない (Tetrahedron Lett ers.,33(42),6319(1992). 参照)。

[0003]

【発明が解決しようとする課題】本発明は、選択分離、

*物。

【化1】

※化学的安定化、不揮発化、粉末化などの技術分野において有用である、テトラキスフェノール類をホストとする新規な包接化合物を提供することを目的とする。また同時に従来の包接化合物の製造方法における以下のような

1) 溶媒の種類によっては、包接化合物を生成しないか 又はゲスト分子を包接せずに溶媒を包接し、溶媒が包接 した化合物が得られる。

2) 包接化合物を生成する溶媒であっても、ゲスト分子 の包接化合物を析出させるためには、温度,ホスト/ゲ スト仕込み比及び濃度,攪拌等の条件が限定されるた め、包接化合物の合成、単離条件設定が難しい。

30 3) ホスト化合物ベースでの回収率が100%とはならない。

を解決し、簡単でかつ効率的な包接化合物の製造方法を も提供することを目的とする。

[0004]

製造上の諸問題点、

【課題を解決するための手段】本発明者らは、前記目的を達成すべく鋭意研究した結果、特定のテトラキスフェノール類のホスト化合物を、ゲスト化合物が液体の場合には、ゲストとする有機化合物中に直接加えて反応させることにより、ゲスト化合物が固体の場合にはゲスト化 合物の含有液中に入れて反応させることにより、若しくは固体であるゲスト化合物と直接に固相反応させることにより、新規な包接化合物が極めて効率よく生成することを見出し、本発明を完成した。

【0005】以下本発明を詳細に説明する。

(ホスト化合物) 本発明において用いるテトラキスフェ ノールのホスト化合物とは、一般式 [I] で表される化 合物である。

[0006]

【化2】

(式中、Xは、 (CH₂)n を表し、nは、0、1、2又 は3であり、R¹、R²は、それぞれ水素原子、低級ア ルキル基、置換されていてもよいフェニル基、ハロゲン 原子または低級アルコキシ基を示す。但し、nがOで、 R¹、R²がともに水素原子である場合を除く。)

【0007】一般式 [I] 中のR¹、R²は、互いに同 一又は相異なっていてもよく、例えば、水素原子、メチ ル基、エチル基、プロピル基、イソプロピル基、n-ブ チル基、イソブチル基、 t ーブチル基、 n ーヘキシル 基、シクロヘキシル基等の低級アルキル基、ハロゲン原 子や低級アルキル基等で置換されていてもよいフェニル 基、フッ素原子、塩素原子、臭素原子、沃素原子等のハ ロゲン原子、メトキシ基、エトキシ基、tーブトキシ基 等の低級アルコキシ基等を挙げることができる。

【0008】本発明で使用されるテトラキスフェノール としては、一般式[I]で表される化合物であれば特に 限定されないが、具体的な例として、1,1,2,2-テトラキス (3-メチル-4-ヒドロキシフェニル) エ タン、1, 1, 2, 2ーテトラキス(3, 5ージメチル -4-ヒドロキシフェニル) エタン、1,1,2,2-テトラキス (3-クロロ-4-ヒドロキシフェニル) エ タン、1, 1, 2, 2ーテトラキス(3, 5ージクロロ -4-ヒドロキシフェニル) エタン、1, 1, 2, 2-テトラキス (3ーブロモー4ーヒドロキシフェニル) エ タン、1, 1, 2, 2-(3, 5-ジブロモー4-ヒド ロキシフェニル) エタン、1,1,2,2ーテトラキス (3-tブチル-4-ヒドロキシフェニル) エタン、 1, 1, 2, 2-テトラキス (3, 5-ジー t ブチルー 4-ヒドロキシフェニル) エタン、1,1,2,2-テ トラキス (3-フルオロ-4-ヒドロキシフェニル) エ タン、1, 1, 2, 2ーテトラキス(3, 5ージフルオ u-4-ヒドロキシフェニル) エタン、1, 1, 2, 2 ーテトラキス (3ーメトキシー4ーヒドロキシフェニ ル) エタン、1, 1, 2, 2ーテトラキス (3, 5ージ メトキシー4ーヒドロキシフェニル) エタン、1,1, 2, 2-テトラキス (3-クロロ-5-メチル-4-ヒ *50 キシフェニル) ペンタン、1, 1, 5, 5-テトラキス

*ドロキシフェニル) エタン、1,1,2,2ーテトラキ ス (3-ブロモー5-メチルー4-ヒドロキシフェニ ル) エタン、1, 1, 2, 2-テトラキス (3-メトキ シ-5-メチル-4-ヒドロキシフェニル) エタン、 1, 1, 2, 2-テトラキス (3-t-ブチル-5-メ 20 チルー4ーヒドロキシフェニル) エタン、1,1,2, 2-テトラキス (3-クロロー5-ブロモー4ーヒドロ キシフェニル) エタン、1,1,2,2-テトラキス (3-クロロー5-フェニルー4-ヒドロキシフェニ ル) エタン、1, 1, 2, 2-テトラキス〔(4-ヒド ロキシー3-フェニル)フェニル]エタン、1,1, 3, 3-テトラキス (4-ヒドロキシフェニル) プロパ ン、1,1,3,3-テトラキス(3-メチル-4-ヒ ドロキシフェニル) プロパン、1, 1, 3, 3-テトラ キス (3、5-ジメチル-4-ヒドロキシフェニル) プ ロパン、1, 1, 3, 3ーテトラキス(3ークロロー4 ーヒドロキシフェニル)プロパン、1,1,3,3ーテ トラキス (3, 5-ジクロロ-4-ヒドロキシフェニ ル) プロパン、1, 1, 3, 3-テトラキス (3, 5-ジクロロー4ーヒドロキシフェニル)プロパン、1, 1, 3, 3ーテトラキス (3ーブロモー4ーヒドロキシ フェニル) プロパン、1,1,3,3-テトラキス (3, 5-ジブロモー4-ヒドロキシフェニル) プロパ ン、1,1,3,3-テトラキス(3-フェニル-4-ヒドロキシフェニル) プロパン、1,1,3,3-テト 40 ラキス (3, 5 - ジフェニルー4 - ヒドロキシフェニ ル) プロパン、1, 1, 3, 3-テトラキス (3-メト キシー4ーヒドロキシフェニル)プロパン、1,1, 3, 3-テトラキス (3, 5-ジメトキシー4-ヒドロ キシフェニル) プロパン、1,1,3,3-テトラキス (3-t-ブチル-4-ヒドロキシフェニル) プロパ ン、1, 1, 4, 4ーテトラキス (3, 5ージー t ブチ N-4-Eドロキシフェニル) ブタン、1, 1, 5, 5ーテトラキス (4-ヒドロキシフェニル) ペンタン、 1, 1, 5, 5ーテトラキス (3ーメチルー4ーヒドロ

• (I)

(3, 5-ジメチルー4-ヒドロキシフェニル) ペンタ ン、1, 1, 5, 5ーテトラキス(3ークロロー4ーヒ ドロキシフェニル) ペンタン、1, 1, 5, 5ーテトラ キス (3, 5ージクロロー4ーヒドロキシフェニル) ペ ンタン、1,1,5,5-テトラキス(3-プロモー4 ーヒドロキシフェニル) ペンタン、1, 1, 5, 5ーテ トラキス(3,5-ジブロモー4-ヒドロキシフェニ ル) ペンタン、1, 1, 5, 5-テトラキス (3-メト キシー4ーヒドロキシフェニル) ペンタン、1, 1, 5, 5ーテトラキス (3, 5ージメトキシー4ーヒドロ キシフェニル) ペンタン、1, 1, 5, 5-テトラキス (3-t-ブチル-4-ヒドロキシフェニル) ペンタ ン、1, 1, 5, 5ーテトラキス (3, 5ージー tーブ チルー4ーヒドロキシフェニル)ペンタン、1,1, 5, 5ーテトラキス (3ーメチルー5ー t ブチルー4ー ヒドロキシフェニ) ペンタン、1, 1, 5, 5-テトラ キス (3-フェニル-4-ヒドロキシフェニ) ペンタ ン、1, 1, 5, 5ーテトラキス (3, 5ージフェニル -4-ヒドロキシフェニル) ペンタン、1,1,5,5 ーテトラキス (3, 5 – ジシクロヘキシルー4 – ヒドロ キシフェニル) ペンタン、1, 1, 4, 4ーテトラキス (4-ヒドロキシフェニル) ブタン、1,1,4,4-テトラキス (3ーメチルー4ーヒドロキシフェニル) ブ タン、1, 1, 4, 4ーテトラキス(3, 5ージメチル -4-ヒドロキシフェニル) ブタン、1,1,4,4-テトラキス (3-クロロー4-ヒドロキシフェニル) ブ タン、1, 1, 4, 4ーテトラキス(3, 5ージクロロ -4-ヒドロキシフェニル) ブタン、1,1,4,4-テトラキス (3ーメトキシー4ーヒドロキシフェニル) ブタン、1, 1, 4, 4ーテトラキス(3, 5ージメト キシー4ーヒドロキシフェニル) ブタン、1,1,4, 4ーテトラキス (3ーブロモー4ーヒドロキシフェニ ル) ブタン、1, 1, 4, 4-テトラキス (3, 5-ジ ブロモー4ーヒドロキシフェニル) ブタン等が挙げられ

る。 【0009】 (ゲスト化合物) 本発明において用いるゲ スト有機化合物としては、前記テトラキスフェノールを ホスト化合物する包接化合物を形成し得るものであれば 良く特に制限されない。 具体的な例としては、メタノ ール、エタノール、i-プロパノール、n-ブタノー ル、2-エチルヘキサノール等のアルコール類、ホルム アルデヒド、アセトアルデヒド、ベンズアルデヒド等の アルデヒド類、アセトン、メチルエチルケトン等のケト ン類、アセトニトリル等のニトリル類、テトラヒドロフ ラン、ジエチルエーテル等のエーテル類、酢酸メチル、 酢酸エチル、酢酸ブチル等のエステル類、シネオール、 ヒノキチオール、メントール、テルピネオール、ボルネ オール、ノポール、シトラール、シトロネロール、シト ロネラール、ゲラニオール、リナロール、ジメチルオク タノール等の天然精油類、キンモクセイ、ジャスミン、

6

レモン等の合成香料類、ピリジン、ピロール、イミダゾ ール、ピラジン、ピラゾール、1, 2, 4ートリアゾー ル、チアゾール、ピロリジン、イミダゾリン、ピロリ ン、オキサゾール、ピペリン、ピリミジン、ピリダジ ン、トリアジン、5-クロロー2ーメチルー4ーイソチ アゾリンー3ーオン等の単環式含窒素複素環化合物等を 例示することができる。

【0010】本発明の化合物は、前記ゲスト有機化合物 若しくはゲスト有機化合物を含有する溶液とホスト化合 物であるテトラキスフェノールとを、常温~100℃で 数分間~数時間攪拌して反応させることにより、ゲスト 有機化合物がホスト化合物に容易に包接され、新規包接 化合物として得ることができる。

【0011】該包接化合物は、減圧下で加熱すると容易 にゲスト化合物を放出すること、更にホスト化合物は水 を包接しないことから、その性質を利用して水とこれら ゲスト化合物の混合物からの分離回収に利用することが できる。

[0012]

【作用】本発明によって、ゲスト有機化合物が液体の場 合にはゲスト化合物と粉末ホスト化合物とを直接反応す ることにより、有機化合物をゲスト分子とする包接化合 物が高選択率及び高収率で生成される。

【0013】また、ゲスト有機化合物が固体の場合には ゲスト化合物の溶液若しくはその固体と粉末ホスト化合 物とを反応することにより、有機化合物をゲスト分子と する包接化合物が高選択率及び高収率で生成される。

【0014】本発明の包接化合物は、ホスト化合物の作 る空洞内にゲスト分子が入り込むことにより生成する。 30 従って、どの化合物がゲストとして取り込まれやすいか 否かは、ゲスト分子の大きさ、立体、極性、溶解度など に支配される。

[0015]

【実施例】以下、本発明を実施例を挙げて更に詳細に説 明する。ただし、本発明はこれらの実施例により何等制 限されるものではない。

(合成例-1) ホスト化合物の合成

チルー4-ヒドロキシフェニル) エタンの合成

300mlフラスコにグリオキザール40%水溶液14. 5gと2,6-キシロール54.9gを仕込み、攪拌し ながら濃硫酸/燐酸 (3/1, v/v) 100mlを、滴 下温度0-2 \mathbb{C} で2時間かけて滴下した。次いで、液温 0℃で4時間攪拌し反応を終了した。反応終了後、反応 液を600mlの氷水に注ぎ込み、70℃まで加温し析出 した固体を濾取した。この固体をジオキサンで再結晶 し、100℃で真空乾燥し、白色粉末15.0g(収率 29.4%) を得た。この粉末が、1,1,2,2ーテ トラキス (3, 5-ジメチル-4-ヒドロキシフェニ 50 ル) エタンであることを I RおよびNMRスペクトルで

8

確認した。各々の測定チャートを図1および図2に示す。

【0016】(1-2) 1, 1, 2, 2-テトラキス(3-メチルー4ーヒドロキシフェニル) エタンの合成300mlフラスコにグリオキザール40%水溶液14.5gとo-クレゾール51.8gを仕込み、攪拌しながら濃硫酸/燐酸(3/1, v/v)100mlを、滴下湿度0-2℃で2時間かけて滴下した。次いで、液温0℃で2時間攪拌し反応を終了した。反応終了後、反応液を600mlの氷水に注ぎ込み、70℃まで加温し析出した固体を濾取した。この固体をジオキサンで再結晶し、100℃で真空乾燥し、白色粉末17.0g(収率37.4%)を得た。この粉末が、1,1,2,2-テトラキス(3-メチルー4-ヒドロキシフェニル)エタンであることをIRおよびNMRスペクトルで確認した。各々の測定チャートを図3および図4に示す。

[0017](1-3)1,1,2,2-7+7+7(3-クロロ-4-ヒドロキシフェニル) エタンの合成 300mlフラスコにグリオキザール40%水溶液14. 5gと2-クロロフェノール56.6gを仕込み、攪拌 しながら濃硫酸/燐酸 (3/1, v/v) 100mlを、 滴下温度0-2℃で2時間かけて滴下した。次いで、液 温0℃で4時間攪拌し反応を終了した。反応終了後、反 応液を600mlの氷水に注ぎ込み、次いで食塩100g を加え、エーテル (100ml×3回) で反応物を抽出し た。エーテル層に無水硫酸ナトリウムを加え脱水した 後、エーテルおよび未反応の2-クロロフェノールを減 圧留去した後、残留物をジオキサンで再結晶し、100 ℃で真空乾燥して、白色粉末7.5g(収率14.0 %) を得た。この粉末が、1,1,2,2-テトラキス (3-クロロー4-ヒドロキシフェニル) エタンである ことをIRおよびNMRスペクトルで確認した。各々の 測定チャートを図5および図6に示す。

[0018](1-4)1, 1, 2, 2-7+7+7(3-ブロモー4-ヒドロキシフェニル) エタンの合成 300mlフラスコにグリオキザール40%水溶液10. 9gと2-ブロモフェノール57.1gを仕込み、攪拌 しながら濃硫酸/燐酸(3/1, v/v) 70mlを、滴 下温度0-2℃で1.5時間かけて滴下した。次いで、 液温0℃で5時間攪拌し反応を終了した。反応終了後、 反応液を500mlの氷水に注ぎ込み、次いで食塩80g を加え、エーテル (100ml×3回) で反応物を抽出し た。エーテル層に無水硫酸ナトリウムを加え脱水した 後、エーテルおよび未反応の2-ブロモフェノールを減 圧留去した後、残留物をジオキサンで再結晶して、10 0℃で真空乾燥し、白色粉末3.1g(収率5.8%) を得た。この粉末が、1,1,2,2-テトラキス(3 ーブロモー4ーヒドロキシフェニル) エタンであること をIRおよびNMRスペクトルで確認した。各々の測定 チャートを図7および図8に示す。

【0019】 (1-5) 1, 1, 4, 4-テトラキス (4-E) (4-E) ブタンの合成 300mlフラスコにグルタルアルデヒド50%水溶液20.0gとフェノール45.1gを仕込み、攪拌しながら濃硫酸/燐酸 (3/1, v/v) 200mlを、滴下温度0-2℃で2時間かけて滴下した。次いで、液温0℃で1.5時間攪拌し反応を終了した。反応終了後、反応液を600mlの氷水に注ぎ込み、70℃まで加温し析出した固体を濾取した。この固体をジオキサンで再結晶し、100℃で真空乾燥して、白色粉末11.9g(収率27.9%)を得た。この粉末が、1, 1, 4, 4-テトラキス (4-E) に対している合成

とをIRおよびNMRスペクトルで確認した。各々の測

定チャートを図9および図10に示す。

【0020】 (1-6) 1, 1, 5, 5-テトラキス (4-ヒドロキシフェニル) ペンタンの合成 300mlフラスコにスクシンアルデヒドナトリウムビス ルファイト25.0gとフェノール38.3g、酢酸50mlを仕込み、攪拌しながら濃硫酸/燐酸 (3/1, v20/v) 100mlを、滴下温度0-2℃で2時間かけて滴下した。次いで、液温0℃で4時間攪拌し反応を終了した。反応終了後、反応液を600mlの氷水に注ぎ込み、70℃まで加温し析出した固体を濾取した。この固体をジオキサンで再結晶し、100℃で真空乾燥して、白色粉末7.0g(収率18.1%)を得た。この粉末が、1,1,5,5-テトラキス(4-ヒドロキシフェニル)ペンタンであることをIRおよびNMRスペクトルで確認した。各々の測定チャートを図11および図12に示す。

【0021】(実施例-1)包接化合物の製造(1) ホスト化合物として、合成例1-1~1-6で得たテト ラキスフェノールを用いて、ゲスト化合物がメタノー ル、エタノール、2-プロパノール、アセトニトリル、 アセトン、THF、1, 4-ジオキサン、ベンズアルデ ヒド、ジエチルアミン、トリエチルアミン、ピリジン、 ベンゼンの包接化合物を製造した。包接化合物の製造 は、ホスト化合物2.5mmolを、ゲスト化合物10 ml中に加え、25~100℃で1~300分攪拌した 後、直ちに濾過し、濾液を室温で1~48時間放置して 結晶を析出させた。この析出物を濾別した後、室温で真 40 空乾燥し、本発明の包接化合物を得た。なお、包接化合 物の確認は、TG-DTA測定およびIRスペクトルに より行った。本実施例の包接化合物製造条件および包接 化合物のTG-DTA測定より求めたゲスト/ホストm o 1 比、ゲスト化合物の再放出温度を表 1 に纏めて示 す。また、IRスペクトルを図13~16に示す。 【0022】 (実施例-2) 包接化合物の製造 (2)

ホスト化合物として、合成例1-2で得た、1, 1, 2, 2-テトラキス (3, 5-ジメチル-4-ヒドロキシフェニル) エタンを用いて、ゲスト化合物がシネオー

ルの包接化合物を製造した。包接化合物の製造は、80 ℃に加温したメタノール 5 mlにホスト化合物 1 mm o l を加え完全に溶解するまで攪拌した後、シネオール4m molを加え、80℃で5分間攪拌した後、直ちに濾過 し、濾液を室温で24時間放置して結晶を析出させた。 この析出物を濾別した後、室温で真空乾燥し、本発明の 包接化合物を得た。なお、包接化合物の確認は、TG-DTA測定により行った。本実施例の包接化合物製造条 件および包接化合物のTG-DTA測定より求めたゲス ト/ホストmol比、ゲスト化合物の再放出温度を表2 に、IRスペクトルを図17に示す。

【0023】 (実施例ー3) 包接化合物の製造 (3) ホスト化合物として、合成例1-2で得た1,1,2, 2ーテトラキス (3ーメチルー4ーヒドロキシフェニ ル) エタンを用いて、ゲスト化合物がヒノキチオール、 チモール、メントール、シトラール、オイゲノール、カ * * ルボン、ゲラニオール、シネオール、メントン、ボルネ オールの包接化合物を製造した。包接化合物の製造は、 60℃に加温したメタノール5mlにホスト化合物1mm o 1を加え完全に溶解するまで攪拌した後、ゲスト化合 物4mmolを加え、60℃で5分間攪拌した後、直ち に濾過し、濾液を室温で24時間放置して結晶を析出さ せた。この析出物を濾別した後、室温で真空乾燥し、本 発明の包接化合物を得た。なお、包接化合物の確認は、 TG-DTA測定により行った。本実施例の包接化合物 製造条件および包接化合物のTG-DTA測定より求め たゲスト/ホストmol比、ゲスト化合物の再放出温度 を表3に纏めて示す。また、IRスペクトルを図18に

[0024] 【表101】

表 1.

			製	造 条	件
No.	ホスト	ゲスト化合物	攪拌温度℃	攪拌時間 min	放置時間Hr
1	1-1	1. 4 - ジオキサン	8 0	5	2 4
2	"	ベンズアルデヒド	100	1 0	2 4
3	"	ベンゼン	5 0	1 0	2 4
4	1 – 2	メタノール	5 0	5	2 4
5	"	エタノール	6 0	5	2 4
6	"	2ープロパノール	2 5	300	11
7	"	アセトニトリル	- 60	5	2 4
8	"	アセトン	5 0	5	2 4
9	"	THF	5 0	5	2 4
1 0	"	1. 4 - ジオキサン	8 0	1 0	2 4
1 1	"	ジエチルアミン	5 0	1	2 4
1 2	"	トリエチルアミン	70	1	2 4
13	"	ピリジン	8 0	1 0	2 4
1 4	"	ベンゼン	7 0	5	2 1
15	1 – 3	アセトニトリル	6 0	5	4 8
16	"	アセトン	5 0	5	2 4
1 7	"	THF	5 0	5	2 4
18	"	ピリジン	8 0	1 0	2 4
19	1-4	1, 4ージオキサン	80	10	2 4
20	1 - 5	2-プロパノール	7 0	5	4 8
2 1	"	アセトニトリル	6 0	5	4 8
2 2	"	THF	5.0	5	4 8
2 3	"	1. 4-ジオキサン	8 0	1 0	4.8
2 4	1 - 6	THF	5 0	5	4 8
2 5	"	1, 4-ジオキサン	8 0	1 0	4 8

【表102】

表(続き)

(7)

	т		TG-DTA	測定	結 果
No.	ホスト	ゲスト化合物	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		再放出温度℃
	1-1	1. 4 - ジオキサン	0. 5	101.3	133.8
2	- "	ベンズアルデヒド	1. 9	178.0	84.5
3	,,	ベンゼン	1. 0	80.0	92.7
4	1 - 2	メタノール	2. 3	64.5	90.5
5	"	エタノール	2. 0	78.3	93.3
6		2-プロバノール	1. 9	8 2 . 4	97.1
7		アセトニトリル	2. 3	8 2. 0	53.9
8	-,,	アセトン	1. 8	56.2	100.1
9	,,,	THF	2. 3	67.0	75.0
10	,,,	1. 4 - ジオキサン	0. 7	101.3	96.1
1 1	 ,-	ジエチルアミン	1. 8	55.0	89.8
1 2		トリエチルアミン	2. 0	88.8	108.3
1 2	"	ピリジン	4. 6	115.0	54.6
1 4	,,,	ベンゼン	2. 0	80.0	136.1
1 5	1 - 3	アセトニトリル	2. 5	82.0	60.4
1 6	"	アセトン	3. 5	5 6. 2	5 6. 9
17		THF	3, 8	67.0	73.4
1 8	 	ピリジン	3. 4	1 1 5. 0	7 3. 4
1 9	1 – 4		2. 9	101.3	101.9
<u> </u>	1 - 4	9 9 1 3	2. 4	8 2. 4	97.3
20		アセトニトリル	2. 1	8 2. 0	8 2 . 8
2 2		THF	2. 2	67.0	5 5. β
2 3		1. 4-ジオキサン	2. 0	101.3	104.3
2 4			1. 9	67.0	
2 5		1. 4 - ジオキサン		101.3	90.6
2 0	L			- 1	

[0026]

【表2】

表 2.

ſ				TG-DTA	F 141 14-	結 果
١	No.	ホスト	ゲスト化合物	ゲスト/キスト mol 比	ゲスト沸点℃	再放出温度℃
Ì	4.57	 	シネオール	2. 0	170	75.8
4 7	1 - 1	7 7 7	L			

[0027]

【表3】

3E. 1

表 3					
			TG-DTA	測定	結 果
No.	ホスト	ゲスト化合物	ゲスト/キスト mol 比	ゲスト沸点℃	再放出温度℃
4 8	1 - 2	ヒノキチオール	2. 1	141	71.1
			0. 8	2 3 3	78.9
49	" _	チモール			47.9
5.0	"	メントール	0.6	215	L
		シトラール	0. 9	2 2 8	111.4
51	"	シトラール		0.5.0	70.5
5 2	"	オイゲノール	0.3	253	
5.0		カルボン	2. 0	2 3 1	110.8
5 3	<u> </u>		1 2	230	89.3
5 4	"	ゲラニオール	1. 0	230	
	,,	シネオール	3. 1	170	63.4
5 5	L		 	207	86.5
5 6	"	メントン	2. 0	201	
5 7	"	ボルネオール	1. 2	214	63.0
1 3 7	1	1			

【0028】前記方法によって得られた各試料は、TG-DTA測定の挙動から、包接体であることが確認された。

[0029]

【発明の効果】本発明のテトラキスフェノールをホスト 化合物とした新規包接化合物は以下の特徴を有する。

- 1)種々の有機化合物がゲスト化合物として極めて容易に包接される。特に、従来知られていた1, 1, 2, 2 ーテトラキス (4ーヒドロキシフェニル) エタンがホストの場合には包接できなかった芳香族炭化水素、例えばベンゼン等も包接可能である。
- 2) 常温付近に沸点を有する化合物を包接することにより、揮発の制御が可能となる。
- 3) 水に混入している有機化合物を、選択的に包接体として回収することが可能になる。
- 4) 蒸留等で分離不可能な、同一沸点を有する有機化合物の混合液から、目的とする化合物を選択的に包接体として分離回収することができる。
- 5) ゲスト分子として取り込んだ化合物を、加熱により簡単に分離回収することができる。
- 6) 包接体は常温で固体であるため、打錠成型も可能であり極めて取扱いが容易である。

従って、本発明は、幅広い範囲の有機化合物を包接化した包接化合物に関し、かつ取扱の容易な新規包接化合物 及びその製造方法を提供するものであり、その産業上に おける意義は極めて大きい。

【図面の簡単な説明】

【図1】合成例1-1で得られた1, 1, 2, 2-テトラキス (3, 5-ジメチルー4-ヒドロキシフェニル)エタンのI Rスペクトル (KBr) 図である。

【図2】合成例1-1で得られた1, 1, 2, 2- テトラキス (3, 5- ジメチルー4- ヒドロキシフェニル) エタンの 1 H- NMRスペクトル図である (d 6 -Aceton e, TMS)。

【図3】合成例1-2で得られた1, 1, 2, 2- テトラキス (3- メチル-4-ヒドロキシフェニル) エタンの I Rスペクトル図 (K Br) である。

【図4】合成例1-2で得られた1, 1, 2, 2- テトラキス (3- メチル-4-ヒドロキシフェニル) エタンの 1 H-NMR スペクトル図である (d-MeOH, TMS)。

【図5】合成例1-3で得られた1, 1, 2, 2-テトラキス (3-クロロ-4-ヒドロキシフェニル) エタンの I Rスペクトル図 (KBr) である。

【図 6 】合成例 1-3 で得られた 1 , 2 , 2- テトラキス (3- クロロー 4- ヒドロキシフェニル) エタンの 1 H-NMR スペクトル図である (d- MeOH, TMS) 。

【図7】合成例1-4で得られた1,1,2,2-テト*

* ラキス (3 - ブロモー 4 - ヒドロキシフェニル) エタン の I R スペクトル図 (K B r) である。

【図8】合成例1-4で得られた1, 1, 2, 2- テトラキス (3- ブロモ-4-ヒドロキシフェニル) エタンの 1 H-NMRスペクトル図である (d-MeOH, TMS)。

【図9】合成例1-5で得られた1, 1, 4, 4-テトラキス(4-ヒドロキシフェニル)ブタンのIRスペクトル図(KBr)である。

【図10】合成例1-5で得られた1,1,4,4-テ 10 トラキス (4-ヒドロキシフェニル) ブタンの'H-N MRスペクトル図である (d-MeOH,TMS)。

【図11】合成例1-6で得られた1, 1, 5, 5- トラキス (4-ヒドロキシフェニル) ペンタンの I Rスペクトル図 (K B r) である。

【図12】合成例1-6で得られた1, 1, 5, 5- トラキス (4-ヒドロキシフェニル) ペンタンの 1 H- NMRスペクトル図である (d-MeOH, TMS) 。

【図13】実施例1で得られた表1のNo.7の包接化合物 [実施例1-2で得られた1,1,2,2-テトラ20 キス(3-メチル-4-ヒドロキシフェニル) エタンをホスト化合物として、アセトンをゲスト化合物とする]のIRスペクトル図(KBr)である。

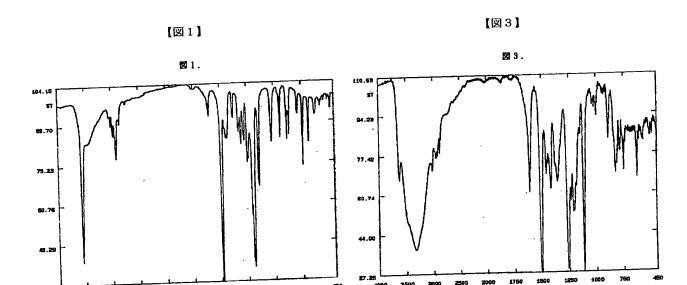
【図14】実施例1で得られた表1のNo. 13の包接化合物 [実施例1-3で得られた1, 1, 2, 2ーテトラキス (3ークロロー4ーヒドロキシフェニル) エタンをホスト化合物として、アセトニトリルをゲスト化合物とする] のIRスペクトル図 (KBr) である。

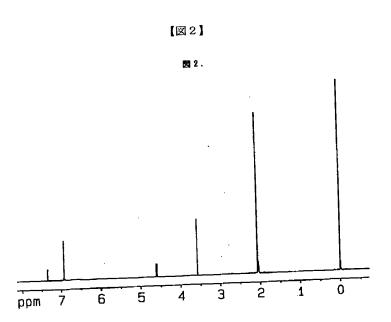
【図15】実施例1で得られた表1のNo. 21の包接 化合物 [実施例1-5で得られた1, 1, 4, 4-デト ラキス (4-ヒドロキシフェニル) ブタンをホスト化合 物として、1, 4-ジオキサンをゲスト化合物とする〕 のIRスペクトル図 (KBr) である。

【図16】実施例1で得られた表1のNo. 23の包接 化合物 [実施例1-6で得られた1, 1, 5, 5-テト ラキス (4-ヒドロキシフェニル) ペンタンをホスト化 合物として、1, 4-ジオキサンをゲスト化合物とす る]のIRスペクトル図 (KBr) である。

【図17】実施例2で得られた表2のNo.24の包接化合物 [実施例1-1で得られた1,1,2,2-テト ラキス (3-メチルー4-ヒドロキシフェニル) エタンをホスト化合物として、シネオールをゲスト化合物とする]のIRスペクトル図 (KBr) である。

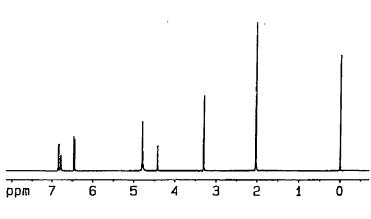
【図18】実施例3で得られた表3のNo. 26の包接化合物 [実施例1-2で得られた1, 1, 2, 2-テトラキス (3-メチルー4-ヒドロキシフェニル) エタンをホスト化合物として、チモールをゲスト化合物とする]のIRスペクトル図 (KBr) である。





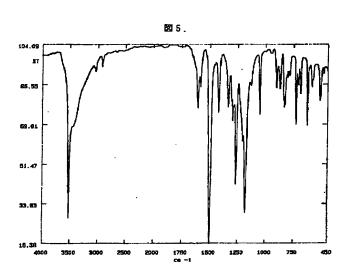
【図4】

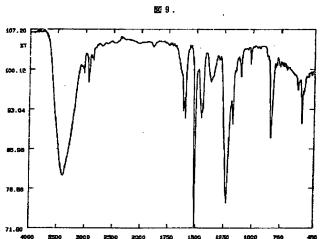
图4.



【図5】

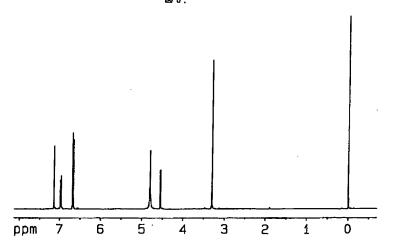
【図9】





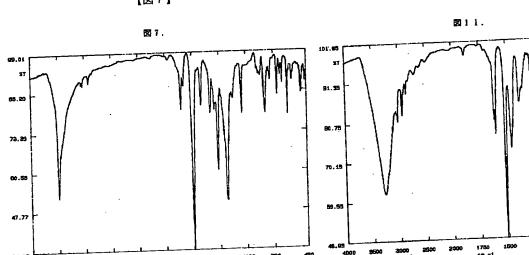
【図6】

图6.



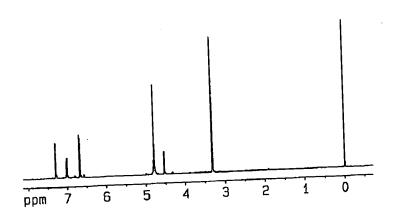
【図11】



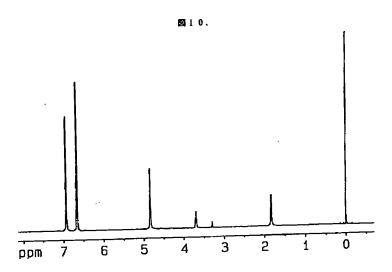


【図8】

图8.

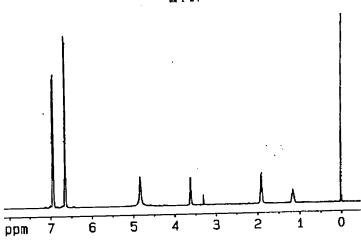


【図10】



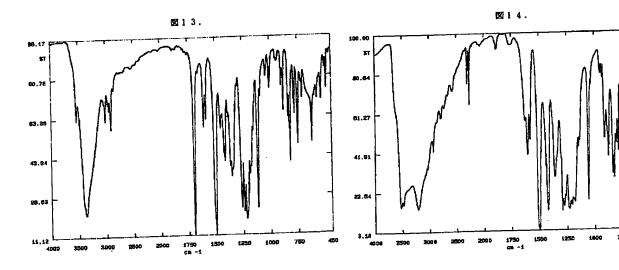
【図12】

図12.

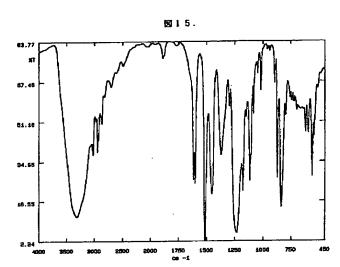


【図13】

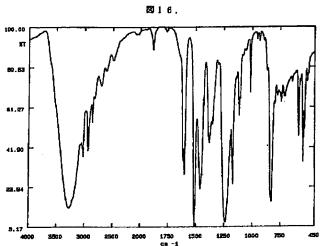
【図14】



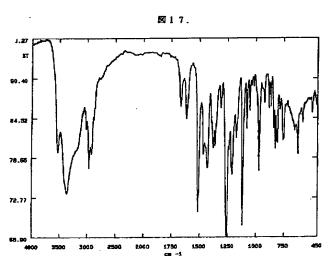
【図15】



【図16】



【図17】



【図18】

